

**デンマーク特許商標庁(DKPTO)と日本国特許庁(JPO)との間の
PCT国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ試行プログラムに関する
DKPTO への申請手続(仮訳)**

DKPTO への申請

出願人は、以下の申請要件を満たすデンマーク特許商標庁への出願につき、関連する書類の提出を含む所定手続を行うことで、PCT 国際段階成果物を利用した日デンマーク間の特許審査ハイウェイ(以下、「PCT-PPH」という)試行プログラムに基づく早期審査を申請することができます。当該出願について PCT-PPH 試行プログラムに基づく早期審査のための申請要件は下記1. を参照してください。また、提出する書類については下記2. を参照してください。

PCT国際段階成果物を利用した特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)

1. 申請要件

デンマーク特許商標庁に出願された出願(以下、当該出願という)について、PCT-PPH に基づく早期審査を申請するためには、下記の要件を満たす必要があります。

1. 1 当該出願と当該出願に対応する国際出願の関係について

当該出願と当該出願に対応する国際出願(以下、「対応する国際出願」という)は、下記(A)～(E)のいずれかの関係を満たすこと。

- (A) 当該出願は、「対応する国際出願」の国内段階である(別紙2 図A, A', A' 参照)。
- (B) 当該出願は、「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている(別紙2 図B参照)。
- (C) 当該出願は、「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である(別紙2 図C参照)。
- (D) 当該出願は、「対応する国際出願」を国内優先権主張又はパリ条約優先権主張の基礎とする国内出願である(別紙2 図D参照)。
- (E) 当該出願は、上記(A)～(D)のいずれかを満たす出願の派生出願(分割出願、国内優先権を主張する出願等)である(別紙2 図E1, E2参照)。

1. 2 当該出願が対応する国際出願の最新国際成果物において特許性有りと示された少なくとも1つの請求項を含むこと

対応する国際出願の国際段階における成果物、すなわち国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA)及び国際予備審査報告(IPER)のうち、最新に発行されたもの(「最新国際成果物」という。)において特許性(新規性・進歩性・産業上利用可能性のいずれも)「有り」と示された請求項が少なくとも1つ存在すること。ただし、国際調査報告(ISR)のみに基づいて PCT-PPH を申請することはできません。

PCT-PPH 申請の基礎とする最新国際成果物の第 VIII 欄に何らかの意見が記載されている場合、第 VIII 欄に記載された意見に対応する補正の如何にかかわらず、出願人は特許性について釈明(特許可能な請求項を特定し説明)しなければなりません。この場合、出願人が特許性について何ら釈明をしないとき、その出願は PCT-PPH 申請の対象となりません。なお、釈明が妥当で

あるか否か、第 VIII 欄に記載された意見に対応する補正がなされたか否かは PCT-PPH の対象となるか否かの判断に影響しません。

また、上記 WO/ISA、WO/IPEA、IPER は日本国特許庁が国際調査機関 (ISA)、国際予備審査機関 (IPEA) として作成したものに限り、国際出願の優先権主張の基礎となる出願はいずれの庁に出願されたものであっても構いません。別紙 2 図 A' を参照してください (ZZ は任意の国内出願)。

1.3 請求項の対応について

PCT-PPH に基づく早期審査を申請する当該出願の全ての請求項が、出願当初のまま又は補正されて、ISA/IPEA としての日本国特許庁において特許性有りとして示された請求項のいずれかと十分に対応していること。

差異が翻訳又は請求項の形式によるものであり、デンマーク特許商標庁の請求項が日本国特許庁において特許性有りとして示された請求項と同一又は類似の範囲を有するか、デンマーク特許商標庁の請求項の範囲が日本国特許庁において特許性有りとして示された請求項の範囲より狭い場合に、請求項は「十分に対応」するとみなされます。

たとえば、日本国特許庁において特許性有りとして示された請求項において、当該出願の明細書 (発明の詳細な説明及び/又は請求項) に裏付けられている技術的特徴を追加することにより限定する補正がなされた場合に、より範囲の狭い請求項が生じます。

日本国特許庁において特許性有りとして示された請求項に対し、新たな又は異なったカテゴリーの請求項は十分に対応しているものとみなされません。たとえば、日本国特許庁において特許性有りとして示された特許請求の範囲が製品製造処理の請求項のみを含む場合、デンマーク特許商標庁の特許請求の範囲が、対応する処理の請求項に従属して製品の請求項を追加していると、デンマーク特許商標庁の請求項は十分に対応しているものとみなされません。

1.4 当該出願に係る「特許通知」がまだ発送されていないこと

デンマーク特許商標庁がまだ「特許通知」を発送していないこと (その通知のタイトルは “Berigtigelse af bilag” 又は “Godkendelse” です)。

2. デンマーク特許商標庁における PCT-PPH 試行プログラムに基づく早期審査の申請ために提出が必要な書類

出願人は PCT-PPH に基づく早期申請を行う際、下記 2.1~2.4 の書類を申請書 (別紙 3 を参照) に添付して提出する必要があります。引用文献を除く全ての書類は、デンマーク語又は英語で作成され又は翻訳されなければなりません。

2.1 対応する国際出願の最新国際成果物の写し

当該出願が上記 1.1 (A) の要件を満たす場合、当該出願の包装情報の一部として特許性に関する国際予備報告 (IPRP) の写しとその英語の翻訳文が含まれるため、出願人はそれらの提出を省略することができます。さらに、“PATENTSCOPE (登録商標)”* で当該最新国際成果物の写しが取得可能である場合、デンマーク特許商標庁から要求されない限り、出願人はそれらの提出

* PATENTSCOPE (登録商標) は、世界知的所有権機関 (WIPO) の特許情報システム (PATENTSCOPE) による国際特許情報検索システム (IP) の登録商標です。

を省略することができます(通常、WO/ISAは”IPRP Chapter I”として、またIPERは”IPRP Chapter II”として優先日から30月で利用可能となります)。

2.2 対応する国際出願の最新国際成果物において特許性有りと示された請求項の写し

最新国際成果物で特許性有りと示された請求項の写しを提出すること。

“PATENTSCOPE(登録商標)”で、特許性有りと示された請求項の写しが取得可能(例:当該出願の国際公開パンフレットが発行済み)である場合、デンマーク特許商標庁から要求されない限り、出願人はその提出を省略することができます。ただし、特許性有りと示された請求項の翻訳は提出が必要です(“PATENTSCOPE(登録商標)”では提供されません)。

2.3 対応する国際出願の最新国際成果物で提示された文献の写し

引用文献が特許文献であれば、当該出願に係る特許庁はこれらの特許文献を通例は入手することができるので、提出を省略できます。ただし、デンマーク特許商標庁が当該文献を入手できない場合には、出願人は当該文献の提出を求められる場合があります。また、非特許文献は、提出を省略することができません。引用文献の翻訳は提出不要ですが、出願人が希望する場合は、PCT-PPHに基づく早期審査の申請時に補助文献の一部として翻訳を提出することができます。

2.4 請求項の対応表

当該出願の全ての請求項と、最新国際成果物で特許性有りと示された請求項との関係を示す対応表を記載した書面を提出してください(別紙1参照)。

2.5 申請書

出願人は、上記2.1~2.4の書類と一緒にPCT-PPHに基づく早期審査のための申請書(別紙3参照)を提出しなければなりません。

なお、上記2.1~2.4の書類について、同時又はすでになされた他の手続きにおいてデンマーク特許商標庁に提出されている場合、その書類の写しを援用することにより当該書類の添付の省略が可能です。

デンマーク特許商標庁における PCT-PPH 試行プログラムに基づく早期審査に関する手続き

出願人は、関連する補助的な書類及び完成した申請書(別紙3を参照)を含めてPCT-PPH試行プログラムに基づく早期審査を申請する書類を提出してください。

デンマーク特許商標庁は、申請を受けると当該出願がPCT-PPHに基づく早期審査の資格があるかを検討します。要件が満たされると判断された場合、当該出願は早期審査に指定されます。

要件が一部満たされていない場合、出願人には申請に不備がある旨が知らされます。出願人は、申請を修正する機会が与えられます。申請の不備が修正されない場合は、当該出願は通常の順番で審査されることが出願人に通知されます。

別紙1

請求項対応表の例

以下のような場合、請求項が「十分に対応」とみなされます。

例1

国際段階における請求項	DKPTOにおける請求項	コメント
1	1	DKPTOの請求項はJPOにおいて特許性ありと判断された請求項に構成要素を付加したものである。

国際段階において特許性ありとされた請求項	DKPTOにおける請求項
<p>A system for presenting a container storing at least one article to a processing tool, comprising:</p> <p>(a) a load port, including:</p> <p>a frame having an opening;</p> <p>a support structure being adapted to receive a container, and</p> <p>a drive mechanism for moving said support structure substantially vertically between a first height and a second height; and</p> <p>(b) a conveyor for movably supporting the container substantially along a container transport plane;</p> <p>wherein a container traveling on said conveyor moves unobstructed over said support structure when said support structure is located in said second height,</p> <p>wherein the container traveling unobstructed does not contact said support structure while traveling over said support structure located at said second height,</p> <p>wherein said support structure, when located at said second height, is located below said transport plane.</p> <p><u>*この追加された部分は国際段階において特許性ありとされた請求項には含まれていませんが、明細書に記載されています。</u></p>	<p>A system for presenting a container storing at least one article to a processing tool, comprising:</p> <p>(a) a load port, including:</p> <p>a frame having an opening;</p> <p>a support structure being adapted to receive a container, and</p> <p>a drive mechanism for moving said support structure substantially vertically between a first height and a second height; and</p> <p>(b) a conveyor for movably supporting the container substantially along a container transport plane;</p> <p>wherein a container traveling on said conveyor moves unobstructed over said support structure when said support structure is located in said second height,</p> <p>wherein the container traveling unobstructed does not contact said support structure while traveling over said support structure located at said second height,</p> <p>wherein said support structure, when located at said second height, is located below said transport plane,</p> <p><u>wherein said support structure, when located at said first height, is located above said transport plane*.</u></p>

例2

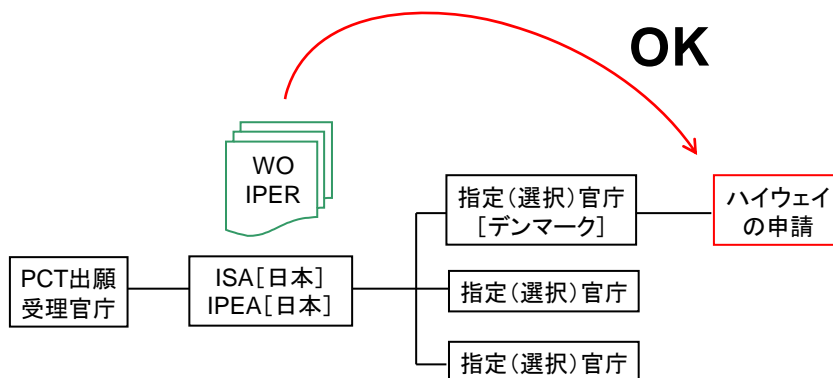
国際段階における請求項	DKPTOにおける請求項	コメント
1	1	同一
なし	2	DKPTOにおける請求項2は、JPOで特許性有りとされた請求項1に対応するDKPTOの請求項1に従属するものである。

国際段階におい特許性有りとされた請求項	DKPTOにおける請求項
1. A nitride-based semiconductor device comprising: a first semiconductor layer, consisting of either an n-type nitride-based semiconductor layer having a wurtzite structure or an n-type nitride-based semiconductor substrate having a wurtzite structure; and an n-side electrode formed on a back surface of said first semiconductor layer, wherein a dislocation density is not more than $1 \times 10^9 \text{cm}^{-2}$ in the vicinity of the interface between said first semiconductor layer and said n-side electrode, and contact resistance between said n-side electrode and said first semiconductor layer is not more than $0.05 \Omega \text{cm}^2$	1. (Same)
2. (None)	2. <i>The nitride-based semiconductor device according to claim 1, wherein said first semiconductor layer includes an n-type dopant*.</i>

*この追加された部分は、国際段階において特許性有りとされた請求項には含まれていませんが、明細書に記載されております。

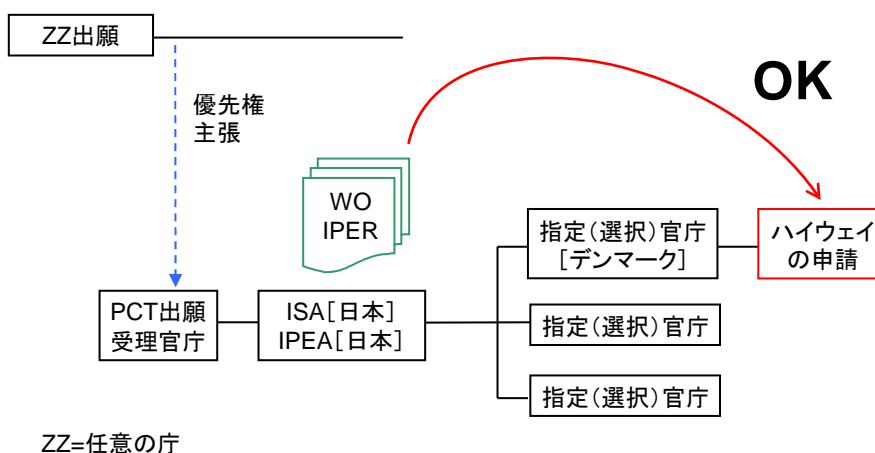
別紙2

(A) 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

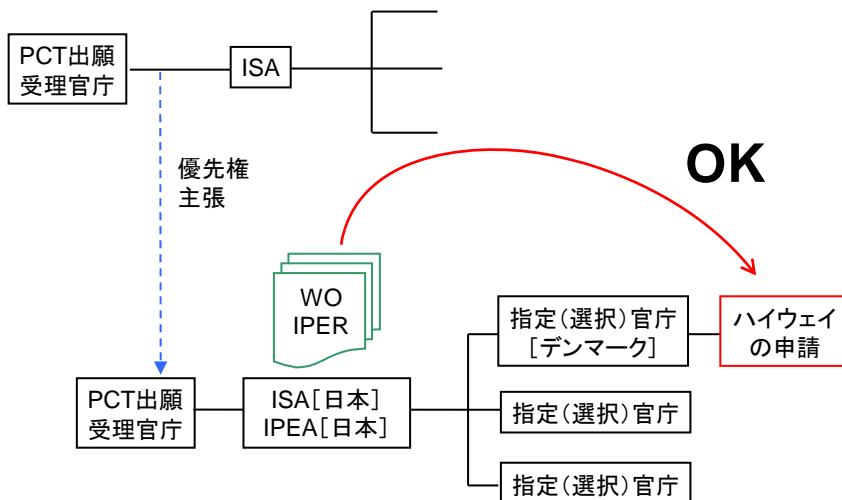


(A') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。

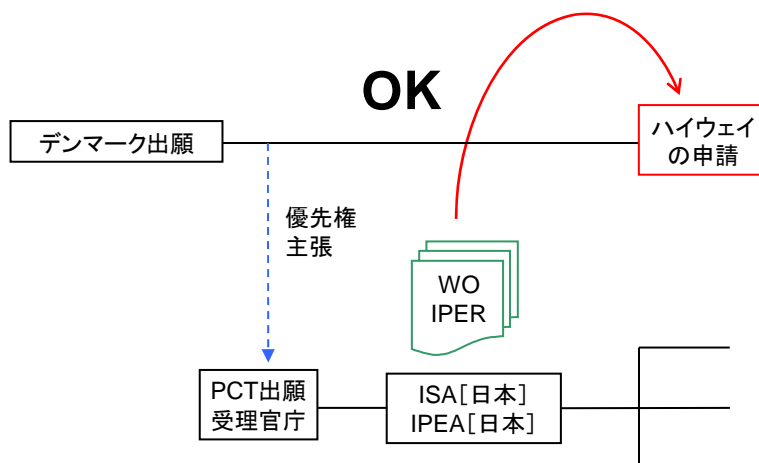
(「対応する国際出願」が国内出願を基礎として優先権を主張している場合)



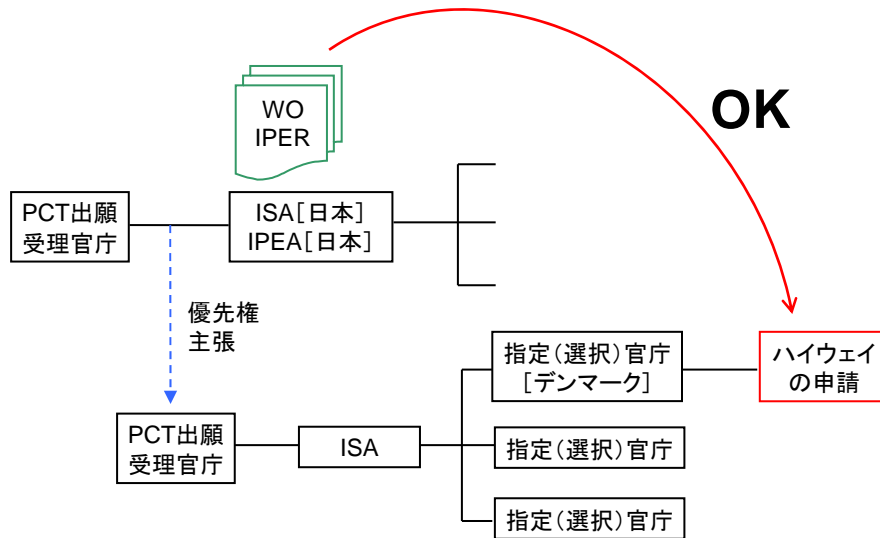
(A') 当該出願は「対応する国際出願」の国内段階である。
 (「対応する国際出願」が国際出願を基礎として優先権を主張している場合)



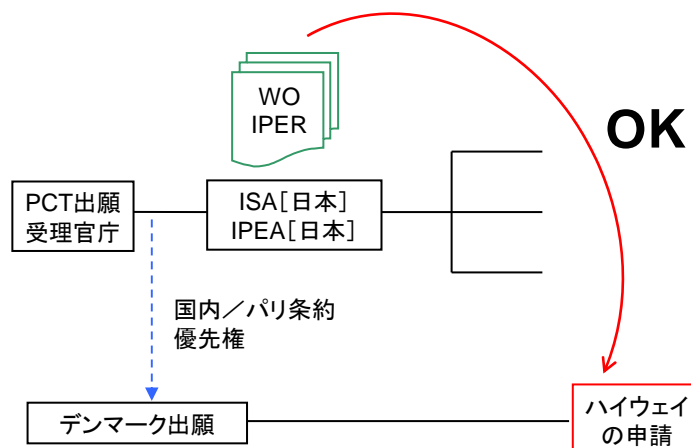
(B) 当該出願は「対応する国際出願」のパリ条約優先権主張の基礎となっている。



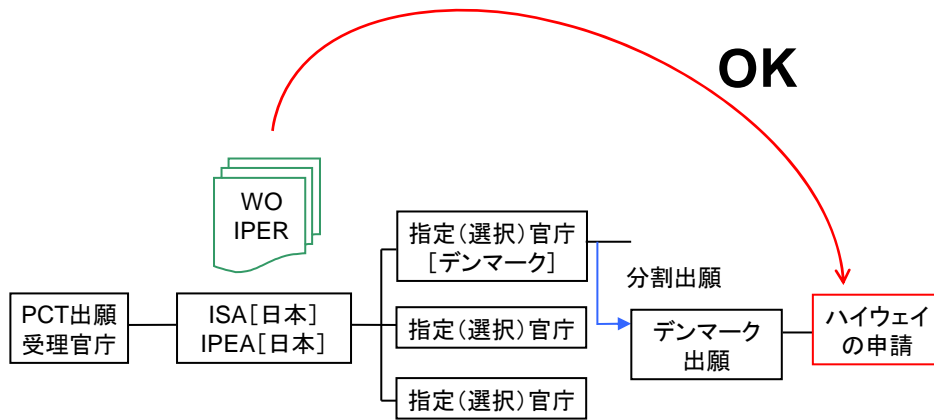
(C) 当該出願は「対応する国際出願」をパリ条約優先権主張の基礎とする国際出願の国内段階である。



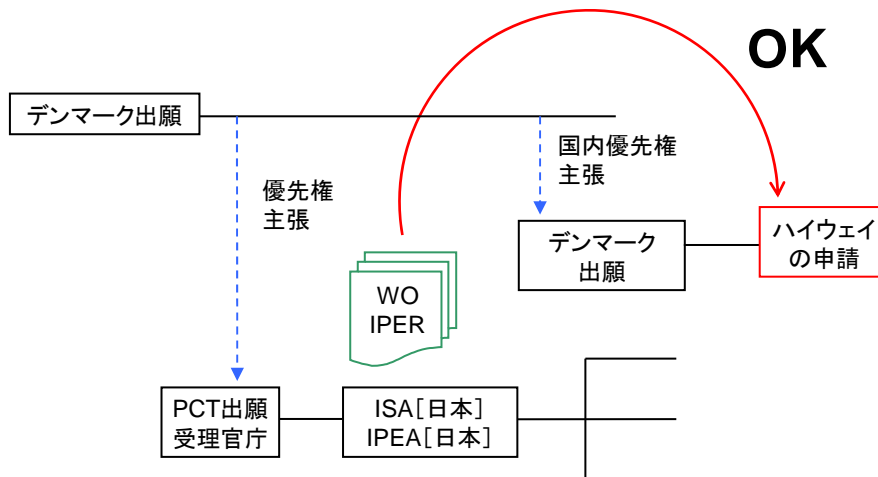
(D) 当該出願は国内出願であり、「対応する国際出願」を国内優先権／パリ条約優先権主張の基礎とする。



(E1) 類型(A)に該当する出願の分割出願である。



(E2) 類型(B)に該当する出願を基礎として国内優先権を主張する出願である。



別紙3

PCT-PPH申請

DKPTO とJPOとの間の特許審査ハイウェイ試行プログラムに基づくPCT国際成果物を利用したDKPTOにおける早期審査(PCT-PPH)の申請

デンマーク出願番号:

対応する国際出願番号:

PCT-PPHを利用するために、次の書類が添付されることが必要である:

1. 次の何れか:
 - 1a) WO/ISA、WO/IPEA又はIPERの写しと英語又はデンマーク語の翻訳
又は
 - 1b) 1a)の書類をPATENTSCOPE®から入手することを請求する

2. 次の何れか:
 - 2a) ISA又はIPEAにおいて特許性有りとされた全ての請求項の写し
又は
 - 2b) 2a)の書類をPATENTSCOPE®から入手することを請求する

3. 上記2.の書類について英語又はデンマーク語の翻訳

4. WO/ISA、WO/IPEA又はIPER において引用された全文献の写し(特許文献は除く)

5. 請求項対応表

